

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
17. April 2003 (17.04.2003)

PCT

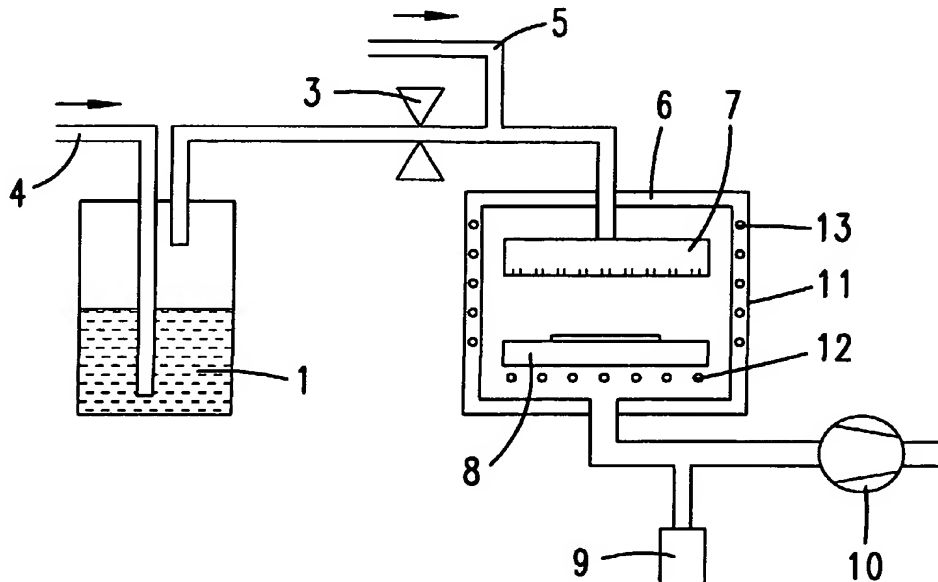
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 03/031677 A1**

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C23C 16/455, H01L 21/02 (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): AIXTRON AG [DE/DE]; Kackertstrasse 15-17, 52072 Aachen (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP02/10051 (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHUMACHER, Markus [DE/DE]; Kunibertusstrasse 42a, 50171 Kerpen (DE).
- (22) Internationales Anmeldedatum: 7. September 2002 (07.09.2002)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch (74) Anwälte: GRUNDMANN, Dirk usw.; Rieder & Partner, Corneliusstrasse 45, 42329 Wuppertal (DE).
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,
- (30) Angaben zur Priorität:  
101 50 776.3 8. Oktober 2001 (08.10.2001) DE  
102 06 984.0 20. Februar 2002 (20.02.2002) DE

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR DEPOSITING A PLURALITY OF LAYERS ON A SUBSTRATE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM ABSCHIEDEN EINER VIELZAHL VON SCHICHTEN AUF EINEM SUBSTRAT



(57) Abstract: The invention relates to a method for depositing a plurality of layers on a substrate using gaseous starting materials, whereby the layers are deposited in one single process chamber in successive process steps. The gas phase composition and/or the substrate temperature is varied without the process chamber being opened in the interim, in such a way that layers of different quality can be deposited successively in one deposition chamber.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 03/031677 A1